

半導体用高純度ガス事業で韓国での合弁会社設立を決定

－半導体メモリの需要拡大に対応－

昭和電工株式会社（社長：市川 秀夫）は、韓国のSK マテリアルズ社（以下、SKM 社）との間で、半導体の製造工程で使われる高純度ガス CH_3F （モノフルオロメタン）の製造・販売を行う合弁会社を設立することで合意をしました。

CH_3F は半導体の製造工程において、窒化膜の微細加工（エッチング）に使用される特殊ガスです。主に微細化を必要とした NAND フラッシュ、DRAM 等の半導体メモリの製造工程で使用されています。 CH_3F は他のガスに比べて高選択比が得られるため、積層化が進んでいる 3D NAND 工程の立ち上げ等の影響で、需要が増加しています。

今般、当社は韓国 SK グループの高純度ガス製造会社である SKM 社と共同で会社を設立し、 CH_3F の製造プラントを新設、販売を行うことについて、SKM 社と基本合意に至りました。会社設立は 17 年 2 月、プラント建設完了は 8 月を予定しています。合弁会社設立後も両社共同の上、半導体・ディスプレイ用高純度ガスをさらに拡大する考えです。

当社の電子材料用高純度ガス事業は 40 年近い歴史を持ち、長年培ってきた精製・分析・品質管理技術において高い評価をいただいています。また当社はフッ素系・塩素系・臭素系・アンモニア系といった多様な高純度ガスを製造・販売する世界唯一の企業として、お客様の製造工程に最適なガスを提案いたします。

当社は、現在推進中の中期経営計画“Project 2020+”において、電子材料用高純度ガスを成長加速事業に位置づけております。当社は今後も、拡大する世界の電子材料市場に迅速に対応し、同事業の強化・拡大を図ってまいります。

以上

〈合弁会社の概要〉

社名	SK 昭和電工株式会社
本社住所	大韓民国 慶尚北道 栄州市
設立日	2017 年 2 月（予定）
資本金	210 億 韓国ウォン（予定）
出資比率	昭和電工 49%、SK マテリアルズ 51%
事業内容	高純度ガス（ CH_3F ）の製造・販売

◆本件に関するお問い合わせ先 広報室 03-5470-3235

